

# スーパークリーンルーム産学官連携研究棟 単価表

2024年4月1日改訂

※ 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当すると判断される場合には、**50%の減額措置**を行います。  
 ※ 処理の内容によっては、単価表に記載された金額よりも高くなる場合もあります。  
 ※ 研究支援施設であるため、大量の試作については受け入れが難しい場合がございます。  
 詳しくは担当窓口までお問い合わせください。

## ● プロセス装置 ・スーパークリーンルーム

| 装置区分             | No.     | 装置番号<br>※注1                          | 施設等名称  | 共用施設等使用料              |                        |                                   | 技術指導費等<br>※注2 |         |         |           |        |
|------------------|---------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|--------|
|                  |         |                                      |  | 標準レシピを使用する場合<br>(円/枚) | チューニングが必要な場合<br>(円/時間) | 同一の標準レシピを使用する場合(～25枚)<br>(円/FOUP) |               |         |         |           |        |
| 露光装置             | 1       | L01-104<br>L01-103                   | ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+)<br>ArF液浸露光装置 (NSR-S610C) ※注3      | 120,000               | 360,000                | 1,500,000                         | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 2       | M01-08<br>M01-10                     | KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)<br>KrF露光装置 (FPA-5000ES3) ※注3 ※注4        | 48,000                | 270,000                | 600,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 3       | U01-102<br>U01-101                   | i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)<br>IRアライメント付i線露光装置 (FPA-5510iZs) ※注3 ※注4 | 48,000                | 270,000                | 600,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
| 塗布現像装置           | 4       | L01-104c                             | ArF液浸レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK LITHIUS i+)                                   | 54,000                | 270,000                | 675,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 5       | M01-08c                              | KrFレジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) ※注4                                     | 36,000                | 180,000                | 450,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 6       | U01-102c                             | i線レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12) ※注4                                      |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 7       | M01-04                               | レジスト塗布現像装置 (CLEAN TRACK ACT 12)  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 成膜装置             | 8       | B03-07                               | プラズマCVD装置 (Eagle-12) ※注4   | 42,000                | 252,000                | 525,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 9       | M03-06                               | プラズマCVD装置 (Eagle-12 Rapidfire) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 10      | B03-06                               | プラズマCVD装置 (VECTOR) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 11      | F03-103                              | プラズマCVD装置 (VECTOR)   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 12      | M03-01                               | 高密度プラズマCVD装置 (Concept 3 Speed)   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 13      | P03-101                              | 高密度プラズマCVD装置 (MAPLE) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 14      | M03-14                               | High-k ALD装置 (Trias-ALD)   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 15      | M06-04                               | メタルCVD装置 (Trias-W)   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 16      | F03-07                               | 窒化膜LP-CVD装置 (TELFORMULA) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 17      | M03-03                               | 酸化膜LP-CVD (TEOS)装置 (TELFORMULA) ※注4  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 18      | P03-103                              | Doped-Si LP-CVD装置 (DJ1226V-DF) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 19      | U03-101B                             | プラズマCVD装置 (PRODUCER GT Staircase) ※注4                                      |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 20      | B06-101                              | バリアシードスパッタ装置 (Endura2 EnCoReII Ta/Cu) ※注4                                  |                       |                        |                                   |               | 60,000  | 180,000 | 750,000   | 15,000 |
|                  | 21      | F06-101                              | 新材料スパッタ装置 (Iarim C-7100GT) ※注4   |                       |                        |                                   |               | 37,000  | 180,000 | 462,500   | 15,000 |
| 22               | M06-03  | メタルスパッタ装置 (GOSMOS I-1201)            |  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 23               | M06-07  | メタルスパッタ装置 (ENTRON W-300) ※注4         |  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 24               | B06-102 | Cuめっき装置 (SABRE NEXT)                 | 75,000   | 210,000               | 937,500                | 15,000                            |               |         |         |           |        |
| エッチング装置          | 25      | M02-04                               | Poly-Siエッチング装置 (Centura DPSII/axiom) ※注4                                   | 97,000                | 270,000                | 1,212,500                         | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 26      | M02-05                               | メタルエッチング装置 (Centura DPSII/ASPII) ※注4                                       | 60,000                | 270,000                | 750,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 27      | B02-101                              | Low-k/メタルエッチング装置 (Centura Enabler/DPS232) ※注4                              |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 28      | M02-01                               | 酸化膜エッチング装置 (Telius SCCM-Ox/DRM-Ox) ※注4                                     |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 29      | M02-10                               | 酸化膜エッチング装置 (Telius DRM-Ox/SCCM-Poly) ※注4                                   | 30,000                | 180,000                | 375,000                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 30      | B02-01                               | Low-kエッチング装置 (Telius SCCM-Ox) ※注4  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 31               | F02-101 | 新材料エッチング装置 (U-8150) ※注4              |  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| アッシング装置          | 32      | B02-03                               | アッシング装置 (ICE300/RPA300) ※注4  | 21,000                | 225,000                | 262,500                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 33      | M02-07                               | アッシング装置 (μ ASH300) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 34      | P02-105                              | アッシング装置 (ICE300/μ ASH300) ※注4  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| イオン注入装置          | 35      | M05-03                               | 高エネルギー中電流イオン注入装置 (EXCEED2300V)   | 103,000               | 294,000                | 1,287,500                         | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 36      | F05-101                              | 低エネルギー高電流イオン注入装置 (SHX)   | 112,000               | 270,000                | 1,400,000                         | 15,000        |         |         |           |        |
| 熱処理装置            | 37      | M03-101                              | RTA/RTP装置 (Radiance) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 38      | M04-02                               | ゲート酸化炉RTO/RTP装置 (Trias SPA300)   |                       |                        |                                   |               | 127,000 | 306,000 | 1,587,500 | 15,000 |
|                  | 39      | B04-01                               | 縦型アニール装置 (VF-5700B) ※注4  |                       |                        |                                   |               | 30,000  | 240,000 | 375,000   | 15,000 |
| 40               | M04-101 | 縦型酸化炉 (ALPHA-303i-K) ※注4             |  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 洗浄装置             | 41      | M07-15                               | バッチ式洗浄装置 (UW300Z) ※注4  | 27,000                | 150,000                | 337,500                           | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 42      | M07-07                               | 酸化膜ウェットエッチング装置 (VENUS) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 43      | P07-104                              | 窒化膜ウェットエッチング装置 (SFAW-1201-008) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 44      | M07-05                               | バッチ式スプレー洗浄装置 (ZETA300 BE) ※注4  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 45      | U07-103c                             | Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット (DGP8761SC)   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 46      | M07-02                               | 枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN MP-3000) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 47      | M07-101                              | 枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 48      | M07-102                              | 枚葉式洗浄装置 (AQUASPIN SU-3000) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 49      | P07-105                              | 枚葉式洗浄装置 (KC-A300CBT) ※注4   |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 50      | M07-13                               | 枚葉式新材料洗浄装置 (SEZ323) ※注4  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 51               | M07-09  | スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4      | 7,000  | 60,000                | 87,500                 | 15,000                            |               |         |         |           |        |
| 52               | M07-12  | スクラブ洗浄装置 (AQUASPIN SS-3000) ※注4      |  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| 53               | N07-101 | STI, W CMP装置 (ChaMP-332M A-FP-3000M) |  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
| CMP装置            | 54      | P07-101                              | Cu CMP装置 (F-REX300E)   | 85,000                | 264,000                | 1,062,500                         | 15,000        |         |         |           |        |
|                  | 55      | U07-101                              | Oxide CMP装置 (Reflexion LK Oxide)   | 97,000                | 390,000                | 1,212,500                         | 15,000        |         |         |           |        |
| 3D実装装置<br>(中間工程) | 56      | B02-101D                             | Si深掘りエッチング装置 (Centura Silvia) ※注4  |                       |                        |                                   |               |         |         |           |        |
|                  | 57      | U03-101A                             | プラズマCVD装置 (PRODUCER GT InViaII) ※注4  |                       |                        |                                   |               | 84,000  | 390,000 | 1,050,000 | 15,000 |
|                  | 58      | U06-101                              | Cuめっき装置 (NEXX Cu ECD)  |                       |                        |                                   |               | 150,000 | 390,000 | 1,875,000 | 15,000 |
|                  | 59      | U12-102                              | ウェハ接合装置 (WS3000)   |                       |                        |                                   |               | 390,000 | 390,000 |           | 15,000 |
|                  | 60      | U07-102                              | ウェハエッジトリミング装置 (DFD6860) ※注4  |                       |                        |                                   |               | 85,000  | 390,000 | 1,062,500 | 15,000 |
| 61               | U07-103 | Si裏面研削研磨装置 (DGP8761SC)               | 171,000  | 390,000               | 2,137,500              | 15,000                            |               |         |         |           |        |

注1～4については2ページ末尾をご参照ください。

## ● 分析装置

### ・スーパークリーンルーム

| 装置区分      | No.    | 装置番号<br>※注1     | 施設等名称                         | 共用施設等使用料     |              |                       | 技術指導費等<br>※注2 |
|-----------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
|           |        |                 |                               | 標準レシピを使用する場合 | チューニングが必要な場合 | 同一の標準レシピを使用する場合(～25枚) |               |
|           |        |                 |                               | (円/枚)        | (円/時間)       | (円/FOUP)              |               |
| 重ね合わせ精度測定 | 62     | M08-55          | 重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM)    |              |              |                       | 15,000        |
|           | 63     | P08-116         | 重ね合わせ精度測定装置 (Archer10-AIM)    |              | 171,000      |                       |               |
| 薄膜解析      | 64     | M08-07          | 分光エリブソ膜厚測定装置 (ASET-F5)        |              |              |                       | 15,000        |
|           | 65     | M08-101         | 分光エリブソ膜厚測定装置 (ASET-F5X)       |              |              |                       |               |
|           | 66     | P08-108         | 分光エリブソ膜厚測定装置 (μ SE-2500-A)    |              | 42,000       |                       |               |
|           | 67     | I08-101         | 分光エリブソ膜厚測定装置 (M-2000X)        |              |              |                       |               |
|           | 68     | AF08-12         | 単色エリブソ膜厚測定装置 (MARY-102SM)     |              |              |                       |               |
|           | 69     | P08-104         | 反射分光膜厚測定装置 (F50-EXR)          |              |              |                       |               |
|           | 70     | M12-08          | 蛍光X線膜厚測定装置 (System 3272E)     |              | 60,000       |                       |               |
| 反り・応力測定   | 71     | F08-04          | X線回折装置 (TTR In-plane XRD)     |              | 84,000       |                       | 15,000        |
|           | 72     | B12-101         | 反り/膜応力自動測定装置 (128LC2C)        |              | 36,000       |                       | 15,000        |
| パーティクル検査  | 73     | M08-12          | 反り/膜応力測定装置 (128L)             |              |              |                       | 15,000        |
|           | 74     | P08-105         | パーティクル検査装置 (WM-10)            |              | 84,000       |                       |               |
| 金属汚染検査    | 75     | P08-106         | パーティクル検査装置 (WM-10)            |              |              |                       | 15,000        |
|           | 76     | P08-107         | 全反射蛍光X線分析装置 (TXRF 310Fab) ※注5 |              |              |                       |               |
| 抵抗測定      | 77     | P08-109         | 自動濃縮装置 (Expert)               |              | 60,000       |                       | 15,000        |
|           | 78     | M08-10          | シート抵抗測定装置 (RS-100)            |              |              |                       |               |
|           | 79     | M08-25          | シート抵抗測定装置 (VR-120/08)         |              | 18,000       |                       |               |
| SEM観察     | 80     | P08-102         | シート抵抗測定装置 (VR300DSE)          |              |              |                       | 15,000        |
|           | 81     | I08-110         | 測長SEM装置 (CG5000)              |              |              |                       |               |
|           | 82     | L08-103         | 測長SEM装置 (CG4000)              |              | 45,000       |                       |               |
|           | 83     | P08-101         | 測長SEM装置 (S-9380 II)           |              |              |                       |               |
|           | 84     | P08-103         | 測長SEM装置 (S-9380 II)           |              |              |                       |               |
| 光学顕微鏡     | 85     | P08-115         | レビューSEM (SEMVision G6)        |              | 162,000      |                       | 15,000        |
|           | 86     | M08-40          | 光学顕微鏡 (AL3110F)               |              |              |                       | 15,000        |
| 87        | M08-50 | 光学顕微鏡 (AL3110F) |                               | 6,000        |              |                       |               |
| 3D実装評価装置  | 88     | M12-101         | 光学顕微鏡 (AL110)                 |              |              |                       | 15,000        |
|           | 89     | M12-102         | 光学顕微鏡 (AL120)                 |              |              |                       |               |
|           | 90     | P08-110         | 超音波顕微鏡 (FastLine P300) ※注5    |              | 36,000       |                       |               |
|           | 91     | P08-111         | 高精度微細形状測定機 (ET4000L) ※注5      |              | 15,000       |                       |               |
|           | 92     | P08-112         | 赤外線顕微鏡システム (DSI-300SA-IR) ※注5 |              |              |                       |               |
|           | 93     | P08-114         | 赤外線拡大鏡 (BL-3000A) ※注5         |              | 6,000        |                       | 15,000        |

### ・スーパークリーンルーム外

|            |     |                  |  |  |        |  |        |
|------------|-----|------------------|--|--|--------|--|--------|
| 高分解能観察     | 94  | J04-106          | ヘリウムイオン顕微鏡 (ORION Plus)                          |  | 48,000 |  | 15,000 |
| FIB加工/STEM | 95  | B08-02-01        | FIB装置 (FB2100)                                   |  | 36,000 |  | 15,000 |
|            |     | AF08-402         | 走査透過電子顕微鏡 (HD-2700) ※注3 ※注5                      |  |        |  |        |
| 断面SEM      | 96  | J03-117          | 走査電子顕微鏡 (S-4700) ※注5                             |  |        |  | 15,000 |
|            | 97  | M08-04           | 走査電子顕微鏡 (S-5000) ※注5                             |  | 15,000 |  |        |
|            | 98  | B08-12           | 走査電子顕微鏡 (S-5200) ※注5                             |  |        |  |        |
| 分析         | 99  | AF08-14          | X線光電子分光分析装置 (ESCA-1800)                          |  | 60,000 |  | 15,000 |
|            | 100 | B10-06           | IR-OBIRCH解析装置 (μ AMOS)                           |  | 60,000 |  | 15,000 |
|            | 101 | J03-116          | 昇温脱離ガス分析装置 (WA1000S/W)                           |  | 57,000 |  | 15,000 |
|            | 102 | J03-114          | 赤外分光分析装置 (Excalibur FTS-3000)                    |  | 66,000 |  | 15,000 |
| 電気特性評価     | 103 | J03-118          | フルオートプローバ (P-12XL)<br>テスター (4073B/N9201A)        |  |        |  | 15,000 |
|            | 104 | M08-42<br>M10-01 | フルオートプローバ (P-12XL)<br>テスター (4073A) ※注3           |  | 57,000 |  |        |
|            | 105 | M10-05           | フルオートプローバ (P-12XL)<br>テスター (4076)                |  |        |  |        |
|            | 106 | F10-01           | セミオートプローバ (S300-861)<br>テスター (4156C/4284A/4294A) |  | 45,000 |  |        |
|            | 107 | J03-115          | 水銀プローバ (SSM 5130)                                |  | 57,000 |  |        |
| シミュレータ     | 108 | SIM-01           | 露光シミュレータ (PROLITH) ※注5                           |  | 60,000 |  | 15,000 |

注1 装置番号は、SCRで装置管理のために使用している番号です。

注2 技術指導費等は、装置使用方法の指導、あるいは特別な作業依頼の場合に、利用者と協議の上で適用いたします。

注3 これらの装置はセットでのご利用となります。

注4 利用促進、中小企業支援、アカデミック利用のいずれかに該当し、かつ、操作方法習得済の利用者自身による夜間等流動の場合、FOUP単位料金の50%減額を行います。

注5 プロセス装置をご利用になられる方のみに利用提供している装置です。

※この単価表に基づく料金に、運営管理費(15%)と消費税が加算されます。(共用施設等利用約款別表第2)

※来所して装置をご利用いただく場合は、利用者に係る人頭経費を徴収させていただきます。(連携研究等経費算定要領別表第3)

※消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てで処理いたします。